

第85回応用物理学会秋季学術講演会シンポジウム

T-11: 先端イオン/電子顕微鏡技術のナノスケール材料・デバイスへの応用展開

Application of advanced ion / electron microscopy for future nano scale materials and devices

2024年9月18日(水) 13:30 ~ 18:15 @ 朱鷺メッセ3F(A36)

ガスイオン源/電子顕微鏡技術を用いた材料物性制御/加工・デバイス創成・評価に関する研究成果を、何が出来るか、何がわかるか、という観点で広く議論し今後の材料、デバイスの研究開発に繋げましょう。Si半導体、二次元材料、超伝導素子などへの応用が講演されます。ガスイオン顕微鏡って何?、という方も是非ご参加ください。

企画: ナノ荷電粒子ビーム産学連携委員会 <https://annex.jsap.or.jp/nanobeam/>
世話人: 小川真一(産総研)、谷口淳(東京理科大)

講演の一部

1. From Dual Damascene to Semi-Damascene and new materials:
Opportunities for characterization in interconnects
Zsolt Tokei (Imec)
2. Evaluation of hydrogen-gas-field-ionization ion source and its application
Shinichi Matsubara (Hitachi, Ltd.)
3. Graphene phononic devices for thermal rectification with He Ion beam technology
Fayong Liu (Ocean University of China)
4. Nanosized quantum sensor spots in hexagonal boron nitride created using helium ion microscopy
Kento Sasaki (Univ. Tokyo)
5. Nanoscale High-Transition Temperature Josephson Junctions and SQUIDs
Shane A. Cybart (University of California, Riverside)
6. In-situ and precise atomic-scale transmission electron microscopy for electronic materials
Yukio Sato (Kumamoto Univ.)
7. Characterization of monolayer film with an advanced ULV-SEM
Takaya Nakamura (JFE Techno-Research Corp.)

